株式会社ダン・タクマ

会社説明

半世紀を超えて最先端技術の未来を支える、クリーン環境のリーディングカンパニー

株式会社ダン・タクマは、1969年8月21日の設立以来、半導体や電子デバイス産業が求める「高度にクリーンな環境」の実現と維持を使命としてきたソリューションプロバイダーです。東証プライム上場の株式会社タクマのグループ企業として、安定した経営基盤を持ちながら、常に革新的な技術開発に挑み続けています。

当社の事業の中核にあるのは、微細化が進むハイテク産業の製造プロセスにおいて、製品の品質と歩留まりを決定づける環境制御技術です。分子状汚染物質（AMC）やナノレベルのダスト、さらには厳密な温度・湿度管理が求められる現場で、当社が提供するソリューションは不可欠なインフラとなっています。本社は神奈川県横浜市の新横浜に構え、国内主要拠点（名古屋、九州、けいはんな、東北）との連携により、迅速なサポート体制を構築しています。

代表取締役 喜多 由樹のリーダーシップのもと、資本金9,000万円、従業員数76名（2025年4月現在）という体制で、お客様の具体的な課題に寄り添い、半世紀以上にわたり蓄積された技術力と豊富な実績を基に、現実的かつ実効性の高いアイデアを提案し、具現化することを強みとしています。

【当社の主要ソリューション】

1. **AMC（分子汚染）対策製品:** クリーンルーム内の不可視な分子状汚染物質（AMC）を徹底的に除去するための高性能なケミカルフィルターや、汚染状況を常時監視・分析するモニタリングシステムを提供し、環境防衛の最前線で貢献します。

2. **クリーン環境装置:** 精密な製造プロセスごとに異なる要求に応じ、分子レベルでの防塵・防汚染対策を実現。超高精度な温度制御を可能にする装置を通じて、製造効率と製品品質の最大化をサポートします。

3. **温湿度制御関連装置:** 微細化が進むことで、よりシビアな管理が求められる乾燥・熱処理工程に対応。高度な清浄度を維持しながら、温度・湿度を厳密にコントロールする特殊装置を提供します。

4. **洗浄装置:** 基板やウェーハから分子レベルの汚染物質を除去する洗浄に加え、製造用治具や部品のオーダーメイド洗浄サービスを提供。特にマイクロバブル技術を応用した高度洗浄は、環境負荷の低減にも貢献する先進的なソリューションです。

5. **磁気シールドチャンバー関連設備:** 電子線描画装置や電子顕微鏡（SEM・TEM）など、磁場変動に極めて敏感な設備の使用環境を最適化。チャンバー内の環境磁界変動を効率的に減衰させるとともに、分子レベルの清浄度とケミカル濃度を制御します。

お客様は国内のみならず、INTEL（米）、TSMC（台湾）、SONYグループ、東芝グループなど、世界のハイテク産業を牽引する大手企業を広く顧客としています。単なる製品の供給業者ではなく、計画立案から販売、供給、そして継続的なメンテナンス、改良開発までを一貫して行う「ソリューション・パートナー」として、半導体製造分野において不可欠な存在であり続けることを志向しています。

会社概要

本社所在地
日本

事業内容
半導体・電子デバイス業界向けクリーン環境の創造および維持に必要な周辺設備の供給、ソリューション提供、および保守サービス。（AMC対策製品、クリーン環境装置、温湿度制御関連装置、洗浄装置、磁気シールドチャンバー関連設備など）

代表取締役
喜多 由樹

設立年
1969年8月21日

資本金
9,000万円

従業員数
51 - 100人

URL
https://www.dan-net.com/

オフィス情報

メインオフィス
〒2220033
神奈川県 横浜市港北区 新横浜3丁目19番1号
LIVMOライジングビル2階